

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ

Российская академия наук (Москва)

Том: 46 Номер: 3 Год: 2020

ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ

- СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КВАЗИКОНТИНУУМА ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЕ** 195-205
Демура А.В., Леонтьев Д.С., Лисица В.С., Шурыгин В.А.

ЛАЗЕРНАЯ ПЛАЗМА

- РЕЗОНАНСНЫЙ ЛАЗЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В ПОЛЕ ЯДРА В ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЕ** 206-212
Дубов А., Дубов В.В., Рощупкин С.П.

ПЫЛЕВАЯ ПЛАЗМА

- УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ПЛАЗМЕННОГО КРИСТАЛЛА** 213-218
Игнатов А.М.
- ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСФЕРУЛ ЛУННОГО РЕГОЛИТА В ИНИЦИИРОВАННЫХ УДАРАМИ МЕТЕОРОИДОВ ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫХ ПРОЦЕССАХ** 219-226
Попель С.И., Голубь А.П., Захаров А.В., Зеленый Л.М.

ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ

- О ВЛИЯНИИ СЛУЧАЙНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ НА СПЕКТРЫ ФЛУКТУАЦИЙ В НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ** 227-236
Пучков В.А.

КИНЕТИКА ПЛАЗМЫ

- СТУПЕНЧАТОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДЛИННОЙ ИСКРЫ В ВОЗДУХЕ** 237-250
Базелян Э.М., Попов Н.А.

ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

- УЧЕТ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ НА УСЛОВИЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО ЗАЖИГАНИЯ ДЕИТЕРИЙ-ТРИТИЕВОГО ТОПЛИВА** 251-256
Nazirzadeh M., Mohammadi S.T., Nanakar H.

НЕЛИНЕЙНЫЕ СТРУКТУРЫ

- РЕШЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО УРАВНЕНИЯ КОРТЕВЕГА ДЕ ВРИЗА-БЮРГЕРСА В ВИДЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ МАГНИТОЗВУКОВЫХ СОЛИТОНОВ В ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОН-ИОННОЙ ПЛАЗМЕ** 257-263
Gao D.N., Wu J.P., Zhang Z.R., Luo D., Lin S.M., Duan W.S., Li Z.Z.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМА

- СИНТЕЗ ОКИСЛОВ АЗОТА В ПОДПОРОГОВОМ МИКРОВОЛНОВОМ РАЗРЯДЕ В ВОЗДУХЕ И В ЕГО СМЕСИ С МЕТАНОМ** 264-272
Артемьев К.В., Батанов Г.М., Бережецкая Н.К., Борзосеков В.Д., Грицинин С.И., Давыдов А.М., Колик Л.В., Кончечков Е.М., Косый И.А., Лебедев Ю.А., Моряков И.В., Петров А.Е., Сарксян К.А., Степахин В.Д., Харчев Н.К., Шахатов В.А.



ИЗМЕРЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ СТРИМЕРА ПРИ ПРОБОЕ ВОЗДУХА В РЕЗКО НЕОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Тарасенко В.Ф., Найдис Г.В., Белоплотов Д.В., Сорокин Д.А., Ломаев М.И., Бабаева Н.Ю.

273-280



ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ НЕОДНОРОДНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Cheong H.W., Lee W., Kim J.W., Cha S., Kim K., Lee H.

281-288